### Литература

- 1. Виноградов М.П., Гусев А.В., Милюков В.К.// Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1997. № 5. С. 37 (Moscow University Phys. Bull. 1997. No.5).
- Милюков В.К., Кравчук В.К. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1996. № 2. С. 73 (Moscow University Phys. Bull. 1996. No.2. P. 60).
- 3. Бичак И., Руденко В.Н. Гравитационные волны в ОТО и проблема их обнаружения. М., 1989.

### УДК 537.52

- 4. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. М., 1983.
- 5. Гуткин Л.С. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуационных помехах. М., 1972.
- 6. *Левин Б.Р.* Теоретические основы статистической радиотехники. Т. 3. М., 1976.
- Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. М., 1973.

Поступила в редакцию 11.04.97

# ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУРФАТРОНА И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ

### Г. С. Солнцев, П. С. Булкин, М. В. Мокеев, Л. И. Цветкова

(кафедра физической электроники)

Физическую модель разряда в сурфатроне можно представить как плазменный столб, вдоль которого от СВЧ-генератора распространяется поверхностная электромагнитная волна. Часть энергии волны  $W_{pl}$  расходуется на поддержание плазмы с высокой концентрацией электронов, а остальная  $W_{vac}$  излучается в окружающее пространство. Рассматривается соотношение между  $W_{pl}$  и  $W_{vac}$  при различшых условиях. Рассчитывается эффективность сурфатрона в качестве плазмотрона и плазменной антенны.

Сурфатроны — приборы, основу которых составляет электрический разряд, создаваемый СВЧ-полем. В настоящее время они применяются в основном как плазмотроны в качестве источников ионов, в газоразрядных лазерах, в плазмохимических установках, источниках спектров [1–3]. Несмотря на это, многие свойства их недостаточно изучены, например пространственное распределение СВЧ-энергии, влияние тепловых эффектов, нелокальная связь СВЧ-поля с характеристиками плазмы, работа в режиме стоячей волны и др.

Физическую модель разряда в сурфатроне можно представить как плазменный столб, вдоль которого от генератора СВЧ или ВЧ-энергии распространяется поверхностная электромагнитная волна (ПВ) [4, 5]. В большинстве работ рассматривают аксиально-симметричную волну с компонентами  $E_z$ ,  $E_r$ ,  $H_{\phi}$ . Такая модель отражает процессы в сурфатроне наиболее простой конструкции, когда окружающее разряд пространство не ограничено. Наличие наружного металлического цилиндра, коаксиального с плазменным, устанавливаемого для экранирования СВЧ-поля, приводит к более сложной электродинамической модели сурфатрона. Такая модель соответствует металлическому волноводу, частично заполненному плазмой [6]. Расчет влияния радиуса экранирующего цилиндра на дисперсионную кривую в предположении, что волноводные моды поля не возникают, проведен в работе [7]. Для применимости простой модели достаточно, чтобы радиус внешнего экрана превышал в несколько раз радиус плазменного столба.

Часть энергии поверхностной волны расходуется на создание и поддержание плазмы с высокой, превыша-

ющей критическую для данной частоты, концентрацией электронов  $(n > n_c)$ . Это условие обеспечивает распространение ПВ вдоль плазменного столба. Величина энергии  $W_{pl}$ , поглощаемой в плазме, определяется балансом числа электронов и их энергии. Она равна энергии, необходимой и достаточной для поддержания стационарного СВЧ-разряда в плазмотроне. Эта энергия ПВ трансформируется в тепловую, световую, химическую энергии.

Остальная часть энергии ПВ  $W_{vac}$  «вытесняется» из плазмы в окружающее разряд пространство вследствие скин-эффекта и излучается в радиальном направлении. Она легко может быть обнаружена, если внести в окружающее сурфатрон пространство неоновую лампочку или диэлектрик с высокими диэлектрическими потерями. Если перемещать в радиальном направлении зонд-детектор электромагнитного поля, то можно установить закон изменения напряженности поля. Этот эффект лежит в основе одного из известных методов измерения концентрации электронов в плазменном столбе [8].

Таким образом, сурфатрон можно рассматривать как плазменный прибор двойного назначения. Он представляет собой, во-первых, *плазмотрон* с высокой концентрацией зарядов, во-вторых, *плазменную антенну* с конечной проводимостью, излучающую энергию в окружающее простанство.

## Основы расчета пространственного распределения СВЧ-энергии

Соотношение между поглощаемой в плазме энергией  $W_{pl}$  и излучаемой наружу  $W_{vac}$  зависит от концентра-

ции электронов *n*, радиуса плазменного столба *R*, частоты поля  $\omega$ , рода газа и его давления. В работе [9] проведен расчет  $W_{pl}$  и  $W_{vac}$  при  $\omega \gg \nu$ , где  $\nu$  — частота электрон-атомных столкновений, для ПВ, распространяющейся вдоль однородного по сечению плазменного цилиндра с радиусом *R* и концентрацией электронов  $\overline{n}$ , окруженного неограниченным пространством. Плотность энергии ПВ уменьшается по мере удаления на расстояние *l* от генератора. Поэтому определяем энергию на единицу длины цилиндра:

$$W_l = \int w(r) \cdot 2\pi r dr = W_{l,pl} + W_{l,vac},$$

$$\begin{cases} W_{l,pl} = \frac{E_0^2 R^2 I_0^2}{8k_1^2} \bigg[ \frac{(2k_z^2 - \varepsilon_{pl} k_1^2) I_1}{k_1 R I_0} - \varepsilon_{pl} k^2 \bigg( 1 - \frac{I_1^2}{I_0^2} \bigg) \bigg], \\ W_{l,vac} = \frac{E_0^2 R^2 I_0^2}{8\varkappa^2} \bigg[ \frac{(k_z^2 + k^2) K_1}{\varkappa R K_0} + k^2 \bigg( 1 - \frac{K_1^2}{K_0^2} \bigg) \bigg]. \end{cases}$$

Здесь w(r) — локальная плотность СВЧ-энергии,  $I_{0,1} = I_{0,1}(k_1R); K_{0,1} = K_{0,1}(\varkappa R)$  — функции Бесселя и Макдональда;  $\varepsilon_{pl} = 1 - \overline{n}/n_c$  ( $n_c$  — критическая концентрация электронов);  $k_z$  — продольное волновое число,  $k_1 = (k_z^2 - k^2 \varepsilon_{pl})^{1/2}; k = \omega/c; \varkappa = (k_z^2 - k^2)^{1/2}.$ 

Формулы (1) применимы к любому плазменному столбу с концентрацией  $\overline{n}$  независимо от способа получения плазмы (метеоритный след, струя реактивного двигателя и т.д.). В случае СВЧ-разряда в сурфатроне, однако, предположение об однородности n по сечению разряда при низком давлении не является строгим из-за скин-эффекта. Строгое обоснование применимости расчета по формулам (1) требует анализа роли переноса электронами энергии, полученной от ПВ из области, где она максимальна (вблизи границы разряда), во внутренние области плазмы [10].

Оценки показывают, что в условиях наших экспериментов длина энергетической релаксации электронов  $\lambda_{T_e}$  удовлетворяет соотношению  $\lambda_{T_e} > R > \delta$  ( $\delta$  — толщина скин-слоя). Поэтому существует нелокальная связь между СВЧ-полем и концентрацией электронов, которая приводит к выравниванию n по сечению разряда  $(n(r) = \overline{n})$ . В работе использовались средние значения  $\overline{n}$ , полученные экспериментально фазометрическим методом.

### 2. Результаты экспериментов

Рассчитаем величины электромагнитной энергии, поглощаемой в плазме  $(W_{l,pl})$  и излучаемой в окружающее пространство  $(W_{l,vac})$  для сурфатрона при радиусе плазмы R = 0, 24 см, частоте поля ~ 3 ГГц с наполнением Хе при давлении 0,7 Торр. Длина разряда составляет 60 см, входная мощность  $W_{inc} = 140$  Вт [11]. Распределение  $\overline{n}(z)$  показано на рис. 1. Разрядная трубка установлена внутри экрана из латунной сетки размерами  $50 \times 40 \times 100$  см. Установка экрана на значительном расстоянии от трубки позволяет пренебречь искажениями поля, вызванными отраженным сигналом. Фазометрическим методом измеряется длина ПВ  $\lambda_z$ , затем по дисперсионной кривой определяется  $\overline{n}$ . Изменение  $\overline{n}$  на расстоянии  $\lambda_z$  не превышало 10–15%.



Рис. 1. Распределение концентрации электронов вдоль цилиндрической (1) и конической трубки (к генератору обращен узкий (2) и широкий (3) концы трубки)



*Рис. 2.* Пространственное распределение СВЧ-энергии в плазме и вакууме вдоль цилиндрической трубки:  $m_{eff} = W_{eff}/(W_{eff} + W_{eff}) = I_{eff}$ 

На рис. 2 показано изменение  $W_{l,pl}/W_{l,vac}$  вдоль разряда. Можно ввести понятие «локальной» (на единицу длины) эффективности  $\eta$  на разном расстоянии z = lот возбудителя ПВ. Величина  $\eta_{pl} = W_{l,pl}/(W_{l,pl}+W_{l,vac})$ определяет степень преобразования энергии ПВ в энергию плазмы, т.е. характеризует «локальную» эффективность сурфатрона как плазмотрона. Она возрастает с увеличением расстояния z от возбудителя ПВ. «Локальная» эффективность  $\eta_{vac} = W_{l,vac}/(W_{l,pl} + W_{l,vac})$ сурфатрона как излучателя электромагнитной энергии в окружающее пространство, наоборот, максимальна в начале разряда и спадает к его концу.

Так как радиус трубки *R* постоянен по длине, то энергообмен ПВ с плазмой и окружающей средой зависит только от продольной концентрации электро-

нов  $\overline{n}(z)$ . В начале разряда  $\overline{n}$  максимальна и максимально «вытеснение» поля ПВ из плазменного столба. Поэтому «локальная» эффективность  $\eta_{pl}$  сурфатрона как плазмотрона мала по сравнению с эффективностью  $\eta_{vac}$  его как антенны. В конце разряда, наоборот,  $\overline{n}$  минимальна и значительная часть энергии ПВ поглощается в плазме. Величины  $\eta_{pl}$  и  $\eta_{vac}$  здесь приблизительно одинаковы и близки к 0,5.

Полученные во многих работах высокие значения эффективности сурфатрона объясняются тем, что в этих работах применялся экран круглого или прямоугольного сечения с размером, близким к диаметру плазмы. ПВ не может при этом распространяться в окружающее плазменный столб пространство, ее энергия локализована внутри экрана-волновода. ПВ трансформируется в волноводные моды или моды ПВ более высокого порядка, что приводит к более эффективному поглощению СВЧ-энергии в плазме.

Согласно (1) распределение энергии ПВ внутри плазменного столба и вне его зависит как от  $\overline{n}$ , так и от R. С целью выяснения условий энергообмена в сурфатроне при одновременном изменении  $\overline{n}(z)$  и R(z)проведены эксперименты с трубкой конической формы. Радиус трубки (длиной 50 см) изменялся от 0,25 до 0,5 см. Трубка могла быть установлена либо узким, либо широким концом около возбудителя ПВ. Распределение концентрации  $\overline{n}(z)$  и величин, характеризующих энергообмен ПВ в сурфатроне с конической трубкой, приведены на рис. 1, 3 и 4. Специфическое продольное распределение  $\overline{n}(z)$  и R(z) приводит к тому, что как  $W_{l,pl}/W_{l,vac}$ , так и  $\eta_{pl}$  максимальны в средней части сурфатрона и минимальны на ее концах. Наоборот,  $\eta_{vac}$  имеет минимум в середине трубки и максимум на концах.

Таким образом, изменение R вдоль трубки позволяет управлять энергообменом ПВ в плазме и окружающем пространстве, т.е. характеристиками сурфатрона в качестве как плазмотрона, так и плазменной антенны. Качественно эти результаты согласуются с влиянием радиуса и проводимости материала на эффективность антенн, применяемых в антенной технике. Возможность использования плазменных антенн с разрядом постоянного тока и их диаграммы направленности описаны в работах [12, 13].

Для того чтобы связать «локальную» эффективность сурфатрона с его полной эффективностью, использована установка с калориметром. Она позволяла определять полную рассеиваемую в разряде мощность  $Q = W_{pl}$  одновременно с подводимой мощностью  $W_{inc}$ . Калориметр состоял из стеклянной трубки диаметром 2,5 см, коаксиальной с разрядной трубкой диаметром 1 см, наполненной Хе при давлении 0,3 Торр. Энергия, выделяющаяся в плазме, поступала в калориметр, через который продувался поток воздуха. Разность температур на входе и выходе была измерена термопарой. При потоке воздуха 0,2 л/с время установления стационарной температуры составляло около 1000 с.



Рис. 3. Пространственное распределение СВЧ-энергии в плазме и вакууме вдоль конической трубки, узкий конец которой обращен к генератору:  $\eta_{l,pl}$  (1),  $\eta_{l,vac}$  (2),  $W_{l,pl}/W_{l,vac}$  (3)



Рис. 4. Пространственное распределение СВЧ-энергии в плазме и вакууме вдоль конической трубки, широкий конец которой обращен к генератору:  $\eta_{l,pl}$  (1),  $\eta_{l,vac}$  (2),  $W_{l,pl}/W_{l,vac}$  (3)

Концентрация электронов *п* определялась в среднем сечении разряда (при z = L/2, где L — длина трубки) по радиальному распределению компоненты поля  $E_r(r)$ снаружи разрядной трубки [8]. Калориметр с разрядной трубкой был окружен цилиндрическим металлическим экраном диаметром ~ 20 см, внутренняя поверхность которого была покрыта слоем материала, поглощающего СВЧ-излучение от трубки. На рис. 5 показана «локальная» эффективность плазменного столба  $\eta_{pl}$  в его середине при различных Winc. Сплошная кривая 1 соответствует расчету по (1), а кружки обозначают результаты измерений Q/Winc, т.е. полной эффективности сурфатрона. Измерения, проведенные при зачерненной поверхности трубки, позволили включить в Q не только тепловое излучение плазмы, но и световые потери энергии в разряде. Отличие экспериментальных значений

 $Q/W_{inc}$  от рассчитанных по (1) при высоких СВЧ-мощностях можно, по-видимому, объяснить отраженной от конца разряда ПВ, не учитываемой при расчетах.



Рис. 5. Относительное изменение СВЧ-энергии и концентрации электронов при различных мощностях в фиксированном сечении z = L/2 цилиндрической трубки:  $l - \eta_{pl} = W_{pl}/(W_{pl} + W_{vac})$ : расчет (сплошная кривая) и эксперимент (точки);  $2 - \eta_{vac} = W_{vac}/(W_{pl} + W_{vac})$ , расчет;  $3 - W_{pl}/W_{vac}$ : расчет (сплошная кривая) и эксперимент (точки);  $4 - \overline{n}/n_c$ (эксперимент)

### Основные выводы

Физическая модель СВЧ-сурфатрона должна включать в себя не только энергию, поглощаемую в плазме, но и энергию, локализованную в окружающем пространстве. Сделан анализ модели с точки зрения влияния конструкции трубки сурфатрона и подводимой мощности  $W_{inc}$  на пространственное распределение энергии ПВ.

Определены условия максимальной «локальной» эффективности сурфатрона как плазмотрона, что важно для его применений в плазмохимических установках [2, 3], в источниках ионов [1], газоразрядных лазерах и источниках света (особенно в импульсном режиме).

Определены также условия максимальной «локальной» эффективности сурфатрона как излучателя электромагнитной энергии в окружающее пространство (плазменной антенны). Внешняя относительно разряда область, в которой происходит распространение ПВ, играет роль реактивной нагрузки СВЧ-генератора, которая эквивалентна сопротивлению в анодной цепи, ограничивающему ток в разряде постоянного тока.

Таким образом, СВЧ-сурфатрон представляет собой прибор двойного назначения, каждое из которых может найти применение.

### Литература

- Hajlaoul Y., Pomathiod Z., Margot Y., Moisan M. // Rev. Sci. Instr. 1991. 62, No.11. P. 2671.
- 2. Gamero A. // Invited Papers XXII ICPIG. 1995. P. 257.
- Sauve G., Moisan M., Poraszcak Y. et al. // Microelectr. Eng. 1989. 9. P. 471.
- 4. Ferreira C.M., Moisan M. // Phys. Scripta. 1988. 38. P. 382.
- Shivarova A., Zhelyazkov I. // Electromagnetic Surface Modes. / Ed. A. D. Boardman. Yohn Wiley & Sons Ltd. 1982. P. 465.
- 6. Пономарев В.И., Солнцев Г.С. // ЖТФ. 1966. **36**, № 8. С. 1376.
- 7. Benova E., Zhelyazkov I. // Phys. Scripta. 1991. 43. P. 68.
- Бобков С.Е., Булкин П.С., Солнцев Г.С., Цветкова Л.И. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1996. № 2. С. 37 (Moscow University Phys. Bull. 1996. No.2. P. 35).
- 9. Кондратенко А.Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме. М., 1985.
- 10. Kortchagen V. // Phys. Rev. 1994. E49, No.5. P. 4369.
- 11. Булкин П.С., Ершов А.П., Солнцев Г.С. и др. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1992. № 1. С. 50 (Moscow University Phys. Bull. 1992. No.1. P. 50).
- Левитский С.М., Бурыкин Ю.И. // Радиотехн. и электроника. 1973. 18, № 12. С. 2642.
- Бурыкин Ю.И., Левитский С.М., Мартыненко В.Г. // Там же. 1975. № 11. С. 2336.

Поступила в редакцию 11.04.97